CLEANING APPARATUS

Patent number:

JP62125619

Publication date:

1987-06-06

Inventor:

TAKIZAWA YOSHIHARU; others: 01

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international:

H01L21/30; B08B7/00; H01L21/302

- european:

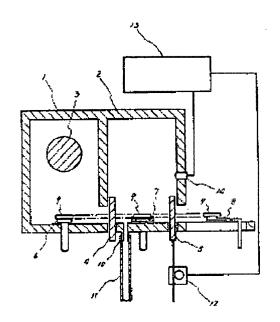
Application number:

JP19850264800 19851127

Priority number(s):

Abstract of **JP62125619**

PURPOSE:To enable the continuous treatment without leakage of ozone outside an apparatus, by providing a sensor having a function of detecting the concentration of ozone inside a preparatory chamber. CONSTITUTION: A conveyor arm 7 of a preparatory chamber has a function of conveying a substance 9 to be cleaned between the preparatory chamber 2 and a cleaning chamber 1 and delivers the same to a cleaning table 6. A microcomputer 13 sends an open/close signal to a door opening/closing unit 12 based on a signal received from a sensor 14, while the atmosphere in the preparatory chamber 2 is exhausted to be treated by an exhaust pipe 11 through an exhaust port 10. The substance 9 to be cleaned is conveyed into the cleaning chamber 1 from the outside of the apparatus by a conveyor arm 8 and the conveyor arm 7 of the preparatory chamber to be cleaned on the cleaning table 6, and is conveyed outside the apparatus again by the conveyor arm 7 of the preparatory chamber and the conveyor arm 8. The movement of the atmosphere occurs on the occasion of conveyance, and consequently the atmosphere in the preparatory chamber 2 is to contain ozone. The concentration of this ozone is detected by a detector 4. Thereby the cleaning treatment can be performed without leakage of harmful ozone outside the apparatus, and the ozone can be incorporated into a cleaning line for continuous treatment after the safety of an operator and the prevention of damage of a peripheral apparatus are secured.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

四公開特許公報(A)

昭62 - 125619

@Int CI 4

識別記号

庁内整理番号

❽公開 昭和62年(1987)6月6

01 21/30 L

08 B 7/00 21/302 Z - 7376 - 5F6420 - 3B

N-8223-5F

B - 8223 - 5F

笨香諳求 発明の数 1 未請求 (全3頁)

匈発明の名称

洗浄装置

創特 願 昭60-264800

23出 願 昭60(1985)11月27日

79発 明 者 淹 沢 芳 治

日立市東多賀町1丁目1番1号 株式会社日立製作所多数

工場内

79発 明 者 大 竹 光 氋

横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所内

の出 願 λ 理

人

個代

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 小川 勝男 外1名

1153 **\$**11 拼

- 発明の名称 洗浄装置
- 特許請求の範囲
 - 1. 酸素ラジカルによる酸化により被洗浄物表 而の有機物を除去する機能を持ち、この処理 を行う洗浄室との間は開閉可能な扉で仕切ら れ、装置外部とも開閉可能な扉で仕切られ、 内部に被洗浄物を保管する機能を持つ予備室 を有する洗浄装匠において、予備室内のオゾ ンの濃度を検出する機能を持つセンサを備え る事を特徴とする洗浄数置。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明は洗枠装置に係り、例えば電子部品、 半導体等の表面の有機物の洗浄に適した洗浄数 履に関する。

(発明の背景)

従来の装置は、特開昭59-94823号。 特開昭59-94824号等の広報に記載のよ うに汝畏185㎜と254㎜の紫外線強度比及

び185mの紫外線強度を設定し、被洗浄物を ベルトコンベアで搬送して洗浄する構造であっ た。 しかし、洗浄の際発生するオゾンはアメリ カ労働衛生専門家会議による許容濃度が0.1 PPmという有害物であるにもかかわらずその 流出防止に対しては何の配慮もなされていなか った。

(発明の目的)

本発明の目的は、洗浄処理時に発生する有害 なオゾンを装置外にもらさずに、連続処理が可 能な洗浄ラインに組み込む事が可能な洗浄装置 を提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明はオゾンを用い有機物を除去する洗浄 装置にオゾンの濃度を検出するセンサを備えた 予備室を設けたものである。有害ガスを用いる 洗浄室をインライン化するには、洗浄室と装置 外部との間に予備室を備け、これを経由して被 洗浄物を搬送する必要がある。これにより洗浄 室から予備室にオゾンが流出した場合、予備室

る。しかし排気処理が不十分な場合流出させる 危険があるため、予備室内のオゾン濃度を検出 し十分排気が行われた後、搬送を行う装置とし たものである。

(発明の実施例)

. з .

かを判定(ステップC)される。オゾンが許容濃 度以下になると予備室原 5 を開き(ステップD) 搬送腕8にて被洗浄物9を予備室2へ搬送(ス) テップE)し、次いで予備室原5を閉じる(ステ ップF)。次に洗浄室原4を開き(ステップG) 予備室搬送腕でにて被洗浄物9を予備室2から 洗浄室1の洗浄台6八般送し(ステップH)、次 いで洗浄室原4を閉じ(ステップI)洗浄を行う (ステップ」)。洗浄終了後、洗浄室原4を開き (ステップ K)、予備室搬送腕7にて洗浄室1の 洗浄台6の被洗浄物9を洗浄予備室2へ搬送し (ステップ L)次いで洗浄室扉々を閉じ(ステッ プM)予備室2内の雰囲気を排気する(ステップ N)。予備室2内の雰囲気中のオゾンは前紀同 様センサで測定し許容濃度以下であるか判定す る(ステップ〇)。許容濃度以上であればステッ プNをくり返し、許容濃度以下であれば予備室 原5を開き(ステップP) 搬送腕8にて被洗浄物 9 を予備室 2 から装置外部へ 搬送し(ステップ Microz 的时间日本的101(7)二二十D1数

管11にて排気処理される。

第2回は前記マイクロコンピュータ13のローチャートを示す。次に本フローチャート 基づいて制御の一例を説明する。ステップA スタートすると予備室内2の雰囲気が排気さる(ステップB)。予備室内2の雰囲気中のオ ンはセンサ14で翻定され許容濃度以下であ

. 4 .

了する。(ステップS)。

これにより例えば許容濃度を 0 . 1 p p m · 設定すれば、装置外部の環境は労働衛生上の1 容限度以下となる。

(発明の効果)

本発明は予備室内の雰囲気をモニターし、? 全を確認した後に原を開くため、有害なオゾ、 を装置外部に漏さずに洗浄処理が行え、作業: の安全及び周辺機器の損失防止を確保した上。 洗浄ラインに組込み連続処理する事が出来る。

4 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例を示す洗浄装置(断面図、第2回は上記洗浄装置を制御するたし のマイクロコンピュータのフローチャートで; る。

1 … 洗浄室, 2 … 予備室, 3 … 水銀灯, 4 · 洗浄原, 5 … 予備室原, 6 … 洗浄台, 9 … 被 i 冷物, 1 0 … 排気口, 1 1 … 排気管, 1 2 … 原開閉器, 1 3 … マイクロコンピュータ, 1 4 …

ىد . . ـــ

